

4. Wafer 세정제

: Wafer 표면의 유기물 및 Wafer 사이의 slurry(SiC, Si, oil) 세정에 사용 됨.

종류	희석율	사용온도	pH	적용 분야
Unisem SWC-W01	5%	60~65°C	알칼리	유기물 및 slurry 제거

1) Unisem SMC-W01

- 수계 세정제
- wafer 표면등에 부착한 입자 오염(유기물)에 대하여 우수한 세정성
- wafer사이에 낀 Slurry (sic:si:oil)세정시 침투가 우수하여 빠른 세정
- 침투, 유화,분산 등이 동시 작용
- 특히, Carbon제거가 용이
- 초음파 공정에 적합

물성/제품명	Unisem SMC-W01
Appearance	Clear and pale Yellow
Specific Gravity(25°C)	1.020±0.010
PH(25°C)	10.5±1.0
Brix(25°C)	15.0±1.0
Alkalinity	0.3±0.1

Before



After

